Температурные и полевые зависимости фотоиндуцированного изменения намагниченности в иттриевом феррите-гранате

© К.М. Мукимов, О.О. Очилов, М.Г. Халмуратов

Научно-исследовательский институт прикладной физики при Ташкентском государственном университете, 700095 Ташкент, Узбекистан

(Поступила в Редакцию 2 июля 1996 г. В окончательной редакции 17 февраля 1997 г.)

Проведены исследования изменения намагниченности железо-иттриевого граната (ЖИГ) при облучении излучением импульсного неодимового лазера с длиной волны $\lambda=1.06\,\mu\mathrm{m}$. Измерения проведены в интервале температур от 100 до 600 К при различных величинах внешнего магнитного поля. Для выяснения внешней анизотропии указанных процессов выбраны монокристаллы ЖИГ, выращенные вдоль кристаллографических направлений (100), (110) и (111). Обсуждаются характерные области температур, в которых доминируют различные механизмы изменения намагниченности под действием лазерного импульса.

Исследование фотомагнитных явлений представляет большой интерес для решения как вопросов фундаментального характера, касающихся взаимодействия с веществом, так и вопросов практического использования этих явлений, например, при создании приемников излучения.

Из анализа литературных данных [1–7] по исследованию динамики фотонамагничивания следует, что к настоящему времени выполнено очень мало исследований, направленных на выяснение зависимости динамики фотонамагниченности от различных факторов, таких как состав материала, внешнее поле, температура и др. В настоящей работе нами были проведены исследования влияния различных факторов на динамику фотонамагничивания в ферритах-гранатах с целью выяснения природы фотомагнитных явлений в магнитных материалах.

В отличие от известных работ [8–11] по изучению фотомагнитных эффектов в ферритах-гранатах, которые традиционно выполнялись на образцах ферритовгранатов, легированных различными примесями, мы провели исследование на нелегированном железо-иттриевом гранате (ЖИГ) как наиболее простом объекте исследования.

В наших предыдущих исследованиях [7] при низких температурах в полях ниже поля технического насыщения наблюдается сильный вклад фотонамагничивания. Несомненно, этот вклад связан с наличием доменной структуры у исследуемых кристаллов. Но причины изменения доменной структуры и ее динамики могут быть весьма разнообразными. В настоящей работе основное внимание было уделено влиянию на процессы фотонамагничивания выбора кристаллографической ориентации облучаемой лазером поверхности исследуемого образца.

Методика эксперимента и результаты

Методика измерений и экспериментальная установка, применявшиеся в исследованиях, описаны в [7]. Указанная установка позволяет проводить измерения фотомагнитных эффектов в интервале температур 100—600 К.

Низкотемпературные измерения на установке выполнялись с помощью оптического криостата, охлаждаемого парами жидкого азота.

На вставке к рис. 1 показан условный сигнал ЭДС измерительной катушки. Символами E^+ и E^- обозначены соответственно положительная и отрицательная амплитуды этого сигнала, измеряемые импульсным вольтметром В4-14. Полученные экспериментальные результаты приведены на рис. 1-3. На этих рисунках показаны температурные зависимости E^+ и E^- при различных величинах внешнего магнитного поля, измеренные на образцах ЖИГ, вырезанных в плоскостях (100), (110), (111). В пределах каждого рисунка величины E^+ и $E^$ одинакового масштаба, и температурные зависимости этих величин приведены в относительных единицах. Знаки этих сигналов условные, и выбор полярности проведен чисто субъективно. Экспериментально установлено, что положительный сигнал вблизи температуры Кюри соответствует отрицательный производной по температуре от спонтанной намагниченности.

Исследованный интервал температур можно условно разделить на три области.

- 1) Высокотемпературная область вблизи температуры Кюри. В этой области наблюдается характерный пик ЭДС в измерительной катушке, определяемый производной по температуре от спонтанной намагниченности. Этот пик наблюдается во всех образцах и, очевидно, связан с разогревом кристалла в результате поглощения лазерного излучения.
- 2) Промежуточная область от 300 К до T_c . Здесь наблюдается появление особенности на крыле пика вблизи T_c (если сигнал в этой области определялся изменением спонтанной намагниченности по температуре, то он соответствовал бы штриховой линии). Это также характерно для всех исследованных образцов.
- 3) Низкотемпературная область ниже 300 К. В этой области наиболее ярко проявляется зависимость ЭДС в измерительной катушке от температуры, внешнего магнитного поля и кристаллографических плоскостей.

Результаты измерений на монокристалле ЖИГ, вырезанном в плоскости (100) (рис. 1), показали следующее. При величине внешнего магнитного поля, равной нулю (H=0), сигнал ЭДС отсутствовал. При $H=60\,\mathrm{kA/m}$ сигнал ЭДС отсутствовал в низкотемпературной области. С увеличением поля (кривые b и c) возникает сильный сигнал ЭДС отрицательной полярности, соответствующий увеличению намагниченности образца, который достигает максимума при $H=160\,\mathrm{kA/m}$. Кроме того, наблюдается сигнал положительной полярности (кривая c), свидетельствующий о дифференциальной форме сигнала ЭДС измерительной катушки (вставка на рис. 1). При дальнейшем росте внешнего поля до $320\,\mathrm{kA/m}$ (кривые d и e) сигналы в низкотемпературной области исчезают.

На рис. 2 показаны результаты измерений на монокристалле ЖИГ, вырезанном в плоскости (110). Для этого монокристалла сильный сигнал ЭДС в низкотемпературной области, как и для случая монокристалла с плоскотью (100), не наблюдается. Для кристалла, вырезанного в

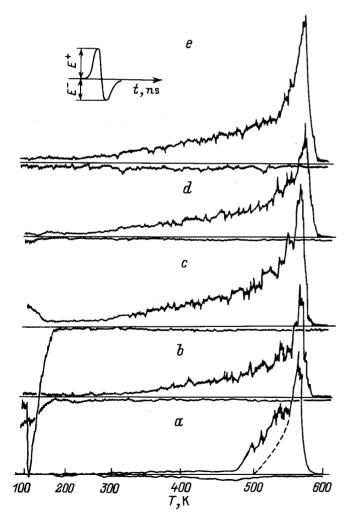


Рис. 1. Температурные зависимости амплитуды ЭДС детекторной катушки для ЖИГ, плоскость (100). Величина внешнего магнитного поля (kA/m): $a-60,\,b-120,\,c-160,\,d-240,\,e-320.$

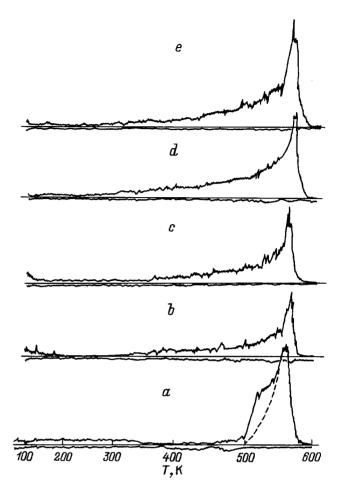


Рис. 2. Температурные зависимости амплитуды ЭДС детекторной катушки для ЖИГ, плоскость (110). Обозначение кривых то же, что и на рис. 1.

плоскости (111) (рис. 3), в низкотемпературной области наблюдаемые зависимости гораздо сложнее, чем для кристаллов с плоскостями (100) и (110). В этой области наблюдается сигнал ЭДС измерительной катушки типа показанного на вставке к рис. 1. Отрицательная часть сигнала с увеличением магнитного поля имеет тенденцию перемещаться в область более низких температур. Максимального значения этот сигнал достигает также при $H=160\,\mathrm{kA/m}$. Положительная часть сигнала также имеет тенденцию сдвигаться в область более низких температур, но при этом амплитуда сигнала ЭДС имеет существенную величину уже в поле $H=60\,\mathrm{kA/m}$. С дальнейшим ростом величины внешнего магнитного поля величина сигнала сначала падает, а затем вновь увеличивается и достигает максимума при $H=160\,\mathrm{kA/m}$.

2. Обсуждение результатов

Как отмечено в работе [7], фотоиндуцированное намагничивание ЖИГ под влиянием лазерного импульса в основном определяется изменением спонтанной на-

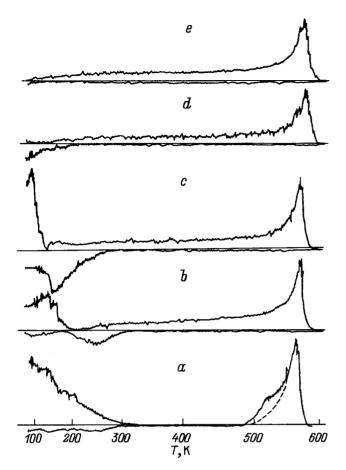


Рис. 3. Температурные зависимости амплитуды ЭДС детекторной катушки для ЖИГ, плоскость (111). Обозначение кривых то же, что и на рис. 1.

магниченности от температуры. Наличие характерного максимума вблизи T_c во всех исследованных образцах (первая область) и сходство форм кривых с производной от спонтанной намагниченности по температуре свидетельствуют о доминирующем вкладе (особенно в первой и второй областях) теплового механизма изменения намагниченности при воздействии лазерного импульса. На ненамагниченных образцах из-за наличия доменной структуры нагрев под влиянием лазерного излучения приводит к одинаковому изменению намагниченности во всех доменах, в результате чего не происходит изменения суммарной намагниченности. Отсутствие сигнала ЭДС на размагниченных образцах является еще одним подтверждением существенной роли теплового механизма фотонамагничивания.

Особенно интересна третья область температурного интервала. Ранее [7] при изучении фотонамагничивания в ферритах-гранатах, легированных ионами Si и Ca, для качественного описания фотомагнитных эффектов в этих материалах было предложено кинетическое уравнение вида

$$dn/dt = kI(t) - (n(t))/\tau,$$

где n — число фотовозбужденных центров, I — интенсивность излучения лазера, T — длительность облучения, τ — время релаксации фотоактивного центра. Это уравнение получено в предположении пропорциональности фотонамагничивания числу фотовозбужденных центров.

При введении в структуру граната ионов Si и Ca создаются искусственно фотоактивные центры, связанные с образованием ионов Fe²⁺ и Fe³⁺. Наши экспериментальные результаты, полученные для ЖИГ с кристаллографическими плоскостями (100), (110) и (111), показывают, что, как и в случае ЖИГ с примесями ионов кремния и кальция, кривые фотонамагничивания можно качественно объяснить с помощью приведенного выше кинетического уравнения. Это свидетельствует о существенной роли примесей, имеющихся в монокристаллах ЖИГ без специального введения в них ионов других элементов.

Таким образом, полученные нами результаты показывают наличие в нелегированных монокристаллах ЖИГ фотоактивных центров естественного происхождения, которые образуются при выращивании этих монокристаллов и отпределяются применяемой технологией, составом шихты, чистотой исходных компонентов, материалом тиглей и др.

Наблюдаемую нами полевую зависимость фотонамагничивания можно объяснить, если учесть наличие в исследованных образцах доменной структуры.

Хорошо известно, что в полях до технического насыщения процесс намагничивания определяется перестройкой доменной структуры, которая может осуществляться путем смещения доменных стенок и разворотом магнитных моментов в доменах. Этот момент очень чувствителен к дефектам в кристалле [6]. При возбуждении фотоактивного центра, связанного с примесями в кристалле, происходит уменьшение намагниченности (положительная часть сигнала), а при прекращении облучения релаксация фотовозбужденного центра и возвращение в первоначальное магнитное состояние, чему соответствует отрицательная часть сигнала, определяющаяся в основном временем релаксации доменной структуры. Наличие характерного максимума в поле порядка 80 kA/m можно объяснить максимальной кривизной зависимости намагниченности от внешнего магнитного поля, что соответствует максимальной чувствительности к изменению намагниченности. В магнитных полях выше поля технического насыщения изменения магнитного состояния, обусловленного процессами перестройки доменной структуры, не происходит, и имеется лишь один небольшой однополярный сигнал, определяемый производной спонтанной намагниченности по температуре.

Авторы выражают искреннюю благодарность И.Д. Ломако за любезно предоставленные образцы.

Список литературы

- [1] А.М. Балбашов, Б.А. Зон, В.Я. Купершмидт, Г.В. Пахомов, Т.Т. Уразбаев. ФТТ **29**, *5*, 1297 (1987).
- [2] Б.А. Зон, В.Я. Купершмидт. ЖЭТФ 84, 2, 629 (1983).
- [3] Б.А. Зон, В.Я. Купершмидт. ФТТ 25, 4, 1231 (1983).
- [4] В.Г. Веселаго, С.Г. Рудов, М.А. Черников. Письма в ЖЭТФ **40**, *5*, 181 (1984).
- [5] Г.М. Генкин, И.Д. Токман. ФТТ 25, 1, 276 (1983).
- [6] В.Ф. Коваленко, Э.Л. Нагаев. УФН 148, 4, 561 (1986).
- [7] В.Н. Гриднев, Р.В. Писарев, С.И. Шаблаев, М.Г. Халмутаров. ФТТ 30, 11, 3399 (1989).
- [8] М.В. Верченко, В.Г. Веселаго, М. Киселевски, С.Н. Ляхимец, А. Мазевски, С.Г. Рудов, У. Читко. Письма в ЖЭТФ **57**, *6*, 352 (1993).
- [9] R. Teatle, D. Temple. Phys. Rev. Lett. 19, 904 (1967).
- [10] H. van der Heide, U. Enz. Solid State Commun. 6, 347 (1968).
- [11] F. Lotgering. J. Phys. Chem. Sol. 36, 1183 (1975).